

高周波誘導加熱真空溶解炉 SVM-20000



高周波誘導加熱真空溶解炉SVM-20000は真空排気後、不活性ガス(Ar)雰囲気中で金属材料を溶解、上部に吊下げられた複数のサンプルを順次、溶湯に浸漬処理させることを目的とした装置です。

また、装置には重量もある溶解金属の投入や残湯処理対策として、傾注機構を付属し、それに伴う付属機構が装備されております。

ルツボの大きさや材質に整合する様、整合器は3タップ切替方式となっておりますので、様々な材料の溶解に適しております。

高周波誘導加熱真空溶解炉 SVM-20000 仕様

- 到達圧力 7.0×10⁻³Pa台以下
※常温・無負荷・脱ガス完了時
- 排気速度 7.0×10⁻³Pa以下迄40分以内
※常温・無負荷・脱ガス完了時
- 溶解量 20kg(鉄換算)
- 加熱温度 ~1800℃
- 昇温性能 Fe15kgを40分で溶解(真空時)
- 溶解室径 φ850mm×1290mmL SUS304
- 溶解機構 50kW9kHz
高周波電源・マッチングボックス
高周波同軸電極・溶解コイル
ルツボ形状:
φ158mm×217mmH(カーボン)・・・サイズや材質は御指定可能
- 付帯機構 炉体傾注機構:インバータモーター駆動型
サンプル吊下げ及び回転/昇降機構
攪拌回転昇降機構
ブリッジブレーカー
試料添加バケツ:φ55mm×70mmH(1式)
測温機構:R/B/K熱電対/温度計
水冷鑄型:SUS304/一本取・・・サイズや材質は御指定可能
- 真空排気系 油回転ポンプ:2500L/min[50Hz]
油拡散ポンプ:5400L/sec水冷パツフル付(ホールドポンプオプション装備)
- 真空計 大気圧検知器/デジタル連成計/サーモカップル真空計/ペニング真空計
- ユーティリティ 電 気:AC200V三相80kVA 計装エア:0.5MPa以上
冷 却 水:100L/min以上0.2MPa以上0.25MPa以下25℃以下循環
- 装置寸法 装置本体:(4000)mmW×(4000)mmD×(3100)mmH・・・最小限設置寸法
制 御 盤:570mmW×700mmD×2100mmH

